

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 11 月 28 日 (2019.11.28)

【公開番号】特開 2018-66960 (P2018-66960A)

【公開日】平成 30 年 4 月 26 日 (2018.4.26)

【年通号数】公開・登録公報 2018-016

【出願番号】特願 2016-207261 (P2016-207261)

【国際特許分類】

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

G 0 2 F 1/1347 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

G 0 9 F 9/00 (2006.01)

【F I】

G 0 2 F 1/13 1 0 1

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

G 0 2 F 1/1347

G 0 2 F 1/1368

G 0 9 F 9/00 3 3 8

G 0 9 F 9/00 3 6 6 A

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 10 月 16 日 (2019.10.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 工程乃至第 7 工程を有し、

前記第 1 工程は、

第 1 支持基板上に、第 1 剥離層と、第 1 樹脂層と、を設ける工程と、

前記第 1 樹脂層上に、第 1 電極を設ける工程と、

前記第 1 電極上に、光拡散層と、第 1 偏光板と、を設ける工程と、を有し、

前記第 2 工程は、

第 2 支持基板上に、第 2 剥離層と、第 2 樹脂層と、第 1 基板と、を設ける工程と、を有

し、

前記第 3 工程は、

前記第 1 支持基板と前記第 2 支持基板とを、前記第 1 偏光板と前記第 1 基板とが向かい合うように第 1 接着層を介して重ねる工程と、

前記第 1 支持基板を介して前記第 1 剥離層に光を照射する工程と、

前記第 1 支持基板および前記第 1 剥離層を前記第 1 樹脂層から分離する工程と、

前記第 1 樹脂層を除去する工程と、を有し、

前記第 4 工程は、

第 3 支持基板上に、第 3 剥離層と、第 3 樹脂層と、第 2 電極と、トランジスタと、第 3

電極と、を設ける工程を有し、

前記第 5 工程は、

第 4 支持基板上に、第 4 剥離層と、第 4 樹脂層と、第 2 基板と、第 4 電極と、を設ける工程を有し、

前記第 6 工程は、

前記第 3 支持基板と前記第 4 支持基板とを、前記第 3 電極と前記第 4 電極とが向かい合うように第 1 液晶層を介して重ねる工程と、

前記第 3 支持基板を介して前記第 3 剥離層に光を照射する工程と、

前記第 3 支持基板および前記第 3 剥離層を前記第 3 樹脂層から分離する工程と、

前記第 3 樹脂層を除去する工程と、を有し、

前記第 7 工程は、

前記第 1 基板と前記第 2 基板を、前記第 1 電極と前記第 2 電極とが向かい合うように第 2 液晶層を介して重ねる工程と、

前記第 2 支持基板を介して前記第 2 剥離層に光を照射する工程と、

前記第 2 支持基板および前記第 2 剥離層を前記第 2 樹脂層から分離する工程と、

前記第 2 樹脂層を除去する工程と、

前記第 4 支持基板を介して前記第 4 剥離層に光を照射する工程と、

前記第 4 支持基板および前記第 4 剥離層を前記第 4 樹脂層から分離する工程と、

前記第 4 樹脂層を除去する工程と、前記第 2 基板上に第 2 偏光板を設ける工程と、

を有する表示装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記第 1 基板の厚さが 0.5 mm 未満である表示装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記第 2 基板の厚さが 0.5 mm 未満である表示装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項において、

前記第 1 樹脂層乃至第 4 樹脂層がポリイミドを有する表示装置の作製方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一項において、

前記光の波長が 180 nm 以上 450 nm 以下である表示装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一項において、

前記第 1 基板上に、反射防止層または防眩層の少なくとも一方が設けられている表示装置の作製方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一項において、

前記トランジスタが酸化物半導体を有する表示装置の作製方法。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか一項において、

前記第 1 電極と前記第 2 液晶層の間に第 1 の配向膜を有し、

前記第 2 電極と前記第 2 液晶層の間に第 2 の配向膜を有する表示装置の作製方法。

【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか一項において、

前記第 3 電極と前記第 1 液晶層の間に第 3 の配向膜を有し、

前記第 4 電極と前記第 1 液晶層の間に第 4 の配向膜を有する表示装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか一項において、

前記第 1 電極と前記光拡散層の間にタッチセンサを有する表示装置の作製方法。